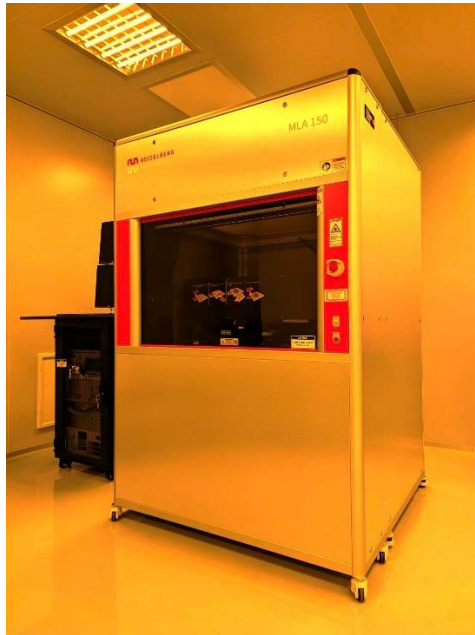


高精度雷射直寫曝光系統



設備負責人：王俊明教授 TEL：07-5252000#6616
Mail：albert.wang@g-mail.nsysu.edu.tw
謝佳旭助理教授 TEL：07-5252000#6618
Mail：ch.hsieh@mail.nsysu.edu.tw
黃義佑特聘教授 TEL：07-5252000#6600
Mail：iyuhuang@mail.nsysu.edu.tw
設備管理人：紀佳伶小姐 TEL：07-5252000#6636
Mail：jlji26@mail.nsysu.edu.tw

儀器資訊：

1. 廠牌型號：海德堡科技 MLA150
2. 購置年限：114 年 5 月
3. 放置地點：電資大樓地下室 EC0001(黃光微影無塵室)
4. 功能：雷射直寫曝光，不須光罩，曝光圖形至有塗佈光阻的基板上
5. 規格：
 - I. 雷射直寫曝光系統：
 - i. 載台可放置 6 吋以下基板(含破片：5 mm*5 mm 以上)。
 - ii. 雷射波長：375 nm
 - iii. 最大寫入區域：150*150 mm²
 - iv. 最小特徵線寬：1 μm
 - v. 最大雷射寫入速率：500 mm²/min
 - vi. 背面對準曝光精度：1 μm
 - vii. 曝光圖檔類型：cif/dxf/gdsii/gerber
6. 目前提供兩種光阻 AZ1505 及 AZ4620，顯影液為 AZ400K。如有自備光阻及藥品，請向管理人員提出申請且經設備負責人同意後才可使用。

7. 預約此機台者請同時於本網站預約清洗蝕刻工作站(有機)。

自行操作：

經具有設備自行操作資格人員訓練後且通過考核方取得自行操作資格。

(詳請參閱：本網頁規章表單>設備操作辦法>自行操作資格取得辦法)

通過考核後，可至「晶片驅動-全台半導體資源共享平台」進行預約及自行操作儀器

委託操作：

請至「晶片驅動-全台半導體資源共享平台」預約，再於本網頁下載委託操作申請表，將申請表填寫好後送至半導體聯合實驗室由管理人員進行委託代工服務。

收費資訊：

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	1500	2000
業界單位	3500	